Гибкие солнечные модули на основе аморфного гидрогенизированного кремния

© Г.М. Аблаев^{+‡¶}, А.С. Абрамов^{+*}, И.А. Няпшаев^{+*}, Ү.К. Vygranenko[#], R. Yang[•], А.Y. Sazonov[•], М.З. Шварц^{+*}, Е.И. Теруков^{+*}

⁺ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

* ООО "НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе",

194064 Санкт-Петербург, Россия

[‡] Санкт-Петербургский Академический университет —

научно-образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

[#] CTS-UNINOVA,

2829-516 Caparica, Portugal

• University of Waterloo,

N2L 3G1 Waterloo, Canada

(Получена 27 октября 2014 г. Принята к печати 6 ноября 2014 г.)

Солнечные модули на легких гибких полимерных подложках обладают рядом несомненных преимуществ, как для наземных, так и для космических применений, по сравнению с солнечными модулями, сформированными на стекле. В данной работе представлены изготовленные тонкопленочные солнечные модули на полимерных подложках толщиной 100 мкм. Каждый модуль с размерами 10×10 см состоит из 72 прямоугольных ячеек, представляющих собой n-i-p-структуру из a-Si:H. Представлены вольт-амперные характеристики изготовленных модулей. Методами инфракрасной термометрии выявлены токи утечки и дефекты полученных структур.

1. Введение

В настоящее время интенсивно разрабатываются различные технологии создания тонкопленочных солнечных элементов. Основными полупроводниками, которые применяются для производства тонкопленочных солнечных элементов, являются кремний, твердые растворы Cu(In,Ga)Se₂, CdTe. Технологии формирования функциональных слоев и материалы, из которых они изготовлены, имеют характерные для каждого из них достоинства и недостатки. Отметим, что хорошо развита технология изготовления кремниевых тонкопленочных солнечных элементов на стеклянных подложках. Тонкопленочные кремниевые солнечные элементы имеют ряд существенных достоинств перед солнечными элементами на основе других материалов и технологий. В частности, имеется возможность наносить слои из аморфного, поликристаллического, микрокристаллического кремния и, следовательно, формировать многокаскадные ячейки. Функциональные слои формируются методом плазмохимического газофазного осаждения (PECVD). Возможно нанесение слоев на поверхность большой площади (до 6 м²). Температура нанесения слоев не превышает 300°С, что позволяет использовать полимерные подложки.

По сравнению с тонкопленочными кремниевыми солнечными модулями, сформированными на стекле, модули на гибких полимерных подложках обладают рядом несомненных преимуществ:

 существенно меньшая стоимость производства полимерных подложек; — возможность использования технологии "roll-toroll", что позволяет производить сотни метров солнечных элементов в течение одного процесса;

— малый вес;

меньшая подверженность механическим повреждениям;

 простота и дешевизна установки и транспортировки модулей.

Подобные солнечные батареи могут быть закреплены на предметах, имеющих сложную, не гладкую поверхность, в том числе и на одежде [1,2]. Кроме того, легкие гибкие солнечные модули на полимерных подложках очень привлекательны для аэрокосмических применений благодаря более высокому отношению вырабатываемой мощности к весу по сравнению с традиционными фотовольтаическими элементами на основе кристаллических Si и GaAs [3].

Использование полимерных подложек накладывает ограничение на температурный режим осаждения. Температура подложки не должна превышать 200°С [4,5]. В этом случае производительность модуля будет ниже, поскольку оптимальный температурный режим для формирования тонкопленочных фотоэлектрических преобразователей на основе a-Si:Н находится в диапазоне 220—300°С [6]. Более низкие температуры процессов приводят к уширению оптической цели поглощающей среды (*i*-слой), что приводит к уменьшению тока короткого замыкания. Для компенсации этого эффекта и для увеличения поглощения света активным полупроводниковым слоем подложки могут быть текстурированы. В работе [7] представлены солнечные однопереходные

[¶] E-mail: gani.ablay@gmail.com

элементы на основе *a*-Si: Н на текстурированной полиэтиленнафталатовой (ПЭН, PEN) подложке с начальной эффективностью 8.8%.

Традиционно кремниевые тонкопленочные солнечные элементы освещаются с *p*-стороны, что позволяет увеличить сбор носителей с малой подвижностью (дырки), поскольку им нужно преодолеть меньшее расстояние для достижения *p*-слоя. Таким образом, при освещении *p*-стороны мы имеем больший ток короткого замыкания [8].

В данной работе представлено подробное описание структуры и формирования солнечных модулей на основе a-Si:Н конфигурации n-i-p на гибкой PEN-подложке толщиной 100 мкм [9]. Конфигурация n-i-p позволяет использовать подложки из непрозрачных материалов (металлическая фольга, полимерные пленки). В ходе эксплуатации засветка происходит со стороны n-i-p-структуры, состоящей из последовательно нанесенных слоев, разделенных с помощью масок в процессе нанесения слоев, при этом оптические свойства подложки не влияют на спектр поглощаемого модулем излучения.

2. Методика эксперимента

На рис. 1 представлен изготовленный солнечный модуль конфигурации n-i-p на гибкой PEN-подложке с размерами 10×10 см.

Солнечный модуль имеет 72 солнечные ячейки, сформированные в виде матрицы 9×8 .

Структура модуля представлена на рис. 2. Ячейки состоят из нижнего контактного слоя Al/Cr, n-i-p-структуры из a-Si:H и верхнего прозрачного контактного слоя ZnO:Al. Для уменьшения сопротивления эмиттера на ZnO:Al симметрично нанесены два алюминиевых полосковых контакта шириной 0.3 мм.



Рис. 1. Солнечный модуль на РЕМ-подложке.



Рис. 2. Структура модуля — вид в разрезе.

Функционально слои выполняют следующие роли:

 металлический подслой необходим для обеспечения наилучшего токосъема и в качестве тыльного отражателя солнечного модуля;

— n-i-p-структура преобразует оптическое излучение в электричество;

— фронтальный слой прозрачного проводящего оксида служит для обеспечения токосъема с n-i-p-структуры;

— задний инкапсулирующий слой *a*-SiO_xN_y предназначен для защиты от влаги и кислорода;

— передний буферный слой *a*-SiO_xN_y необходим для улучшения адгезии.

Процесс изготовления солнечного модуля начинается с промывки полимерных подложек в изопропаноловой ванне. После сушки на подложку наносятся задний инкапсулирующий и передний буферный SiO_xN_y слои в реакторе PECVD при температуре ~ 140°C. После достижения давления ниже $2 \cdot 10^{-6}$ Торр производится распыление 200 нм Al в Ar-плазме при давлении 5 мТорр на подложку с предварительно закрепленной на ней маской № 1. Затем при схожих параметрах процесса напыляется буферный слой Cr (~ 20 нм).

Формирование n-i-p-структуры осуществляется в кластерном реакторе PlasmalabPro 100 PECVD Cluster System, частота 13.56 МГц. Осаждение легированных и нелегированных слоев проводится в разных камерах для предотвращения загрязнения.

Осаждение n-i-p-структуры (n-слой 25 нм, i-слой 300 нм, p-слой 15 нм) проводилось с использованием следующих газовых смесей: SiH₄ + H₂ + PH₃, SiH₄ + H₂, SiH₄ + H₂ + CH₄ + B₂H₆. При этом были выдержаны следующие соотношения потоков газов: [H₂]/([H₂] + + [SiH₄]) = 75%, [PH₃]/[SiH₄] = 1%, [B₂H₆]/[SiH₄] = 1% и [CH₄]/[SiH₄] = 67%. Осаждение осуществлялось при температуре 150°С, давлении 600 мТорр и плотности мощности высокочастотной (BЧ) плазмы 22 мВт/см².

Формирование верхнего контактного слоя ZnO: Al толщиной 170 нм производилось распылением через маску № 2 в Ar-плазме при давлении 4 мТорр, 80 Вт ВЧ мощности, и температуре подложки 150°С. Поверхностное сопротивление слоя составило 60 Ом/см².

Маска № 3 используется в установке реактивного ионного травления для формирования отдельных ячеек. Структура n-i-p из a-Si:Н выборочно травится в плазме SF₆ при давлении 60 мТорр, потоке газа 15 sccm, и ВЧ мощности 50 Вт. Время травления 90 с. После процедуры сухого травления, слой Аl толщиной 150 нм распыляется через маску № 3 при тех же параметрах процесса, что и при формировании нижнего металлического слоя, обеспечивая последовательное соединение ячеек.

3. Экспериментальные результаты

На рис. З представлена спектральная зависимость квантовой эффективности. Значения квантовой эффективности для света с длиной волны > 550 нм невысоки, поскольку, как мы уже отметили выше, температуры процессов осаждения были ниже оптимальных, что привело к уширению оптической щели *i*-слоя.



Рис. 3. Спектральная зависимость внешнего квантового выхода.



Рис. 4. Световая ВАХ одной ячейки.



Рис. 5. ВАХ одной секции модуля, состоящей из 18 последовательно соединенных ячеек (a), и модуля, состоящего из 4 таких секций (b).

Были исследованы световые вольт-амперные характеристики (ВАХ) ячейки, секции из 18 ячеек и модуля из 4 секций. Измерения проводились при стандартном освещении АМ1.5G от имитатора солнечного излучения.

На рис. 4 представлена ВАХ одной ячейки изготовленного модуля и приведены напряжение холостого хода U_{oc} , ток короткого замыкания I_{sc} , кпд η , максимальная вырабатываемая мощность P_{max} , напряжение и ток в точке максимальной мощности — U_{mpp} и I_{mpp} соответственно. Фотоактивная площадь ячейки 0.8 см². По методике, описанной в [10], из ВАХ одной ячейки были получены следующие значения для последовательного и шунтирующего сопротивлений: $R_s = 28.9$ Ом, $R_{\text{sh}} = 1754$ Ом. В перспективе, для увеличения фактора заполнения ВАХ и кпд ячейки необходимо понизить последовательное сопротивление и увеличить шунтирующее. Для этого нужно увеличить эффективность токосьема и устранить токи утечки.

На рис. 5 представлены ВАХ одной секции изготовленного модуля, состоящей из 18 последовательно соединенных ячеек, и модуля, состоящего из 4 таких секций. Размеры модуля составляют 10×10 см. Более низ-



Рис. 6. Термографические снимки одной секции модуля (№ 3) с приложенным прямым смещением.

кий кпд секции (2.9%) по сравнению с кпд ячейки (3.8%) обусловлен снижением всех выходных параметров. Это связано с увеличением активной площади приборной структуры, что в свою очередь увеличивает вероятность формирования макродефектов, обусловленных недостаточной степенью чистоты лабораторного помещения для изготовления приборных структур фотоэлектрических преобразователей. Кроме того увеличивается последовательное сопротивление, обусловленное соединением ячеек в секции.

Производительность полученных модулей оказалась невысокой, ~ 2.6%, что объясняется присутствием ячеек с паразитными сопротивлениями.

С помощью методов инфракрасной (ИК) термографии можно выявить наличие шунтирующих сопротивлений и токов утечки. На рис. 6 представлены ИК снимки, полученные с помощью установки Thermosensorik TDL 640-XL. Для обнаружения шунтов и токов утечки на секцию модуля № 3 подано напряжение прямого смещения. При протекании тока через структуру шунтирующие сопротивления начинают нагреваться, что видно на термографических снимках.

4. Заключение

Были изготовлены тонкопленочные солнечные модули из a-Si: H размерами 10×10 см на PEN-подложках толщиной 100 мкм. Представлены вольт-амперные характеристики изготовленных модулей при стандартном освещении AM1.5G от имитатора солнечного излучения. Методами ИК термометрии были выявлены токи утечки и дефекты полученных структур, которые значительно влияют на производительность модулей.

Необходимо дальнейшее улучшение параметров модулей, которого можно достичь уменьшением токов утечки и повышением эффективности токосъема.

Список литературы

[1] Y. Ichikawa, T. Yoshida, T. Hama, H. Sakai, K. Harashima. Sol. Energy Mater. Solar Cells, **66**, 107 (2001).

- [2] M.B. Schubert, R. Merz. Phil. Mag., 89, 2623 (2009).
- [3] K. Beernink, S. Guha et al. NASA/CP-214494, 54 (2007).
- [4] T. Söderström, F.-J. Haug, V. Terrazzoni-Daudrix, C. Ballif. J. Appl. Phys., 103, 114 509 (2008).
- [5] J.K. Rath, M. Brinza, Y. Liu, A. Borreman, R.E.I. Schropp. Sol. Energy Mater. Solar Cells, 94, 1534 (2010).
- [6] J. Poortmans, V. Arkhipov. *Thin Film Solar Cells Fabrication, Characterization and Applications* (John Wiley & Sons Ltd, 2006) chap. 5.
- [7] F.-J. Haug, T. Söderström, M. Python, V. Terrazzoni-Daudrix, X. Niquille, C. Ballif. Sol. Energy Mater. Solar Cells, 93, 884 (2009).
- [8] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, ed. by A. Luque, S. Hegedus (J. Wiley and Sons, 2003).
- [9] Y. Vygranenko, A. Khosropour, R. Yang, A. Sazonov, A. Kosarev, A. Abramov, E. Terukov. Can. J. Phys., doi 10.1139/cjp-2013-0566.
- [10] C. Zhang, J. Zhang, Y. Hao, Z. Lin, C. Zhu. J. Appl. Phys., 110, 064504 (2011).

Редактор Л.В. Шаронова

Hydrogenated amorphous silicon photovoltaic modules on flexible polymer substrates

G.M. Ablayev^{+‡}, A.S. Abramov^{+*}, I.A. Nyapshaev^{+*}, Y.K. Vygranenko[#], R. Yang[•], A.Y. Sazonov[•], M.Z. Shvarts^{+*}, E.I. Terukov^{+*}

⁺ loffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia
* Research and Development Center for Thin Film Technologies in Energetics under loffe Institute LLC, 194064 St. Petersburg, Russia
[‡] Saint Petersburg Academic University — Nanotechnology Research and Education Centre, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia
CTS-UNINOVA, 2829-516 Caparica, Portugal
• University of Waterloo, N2L 3G1 Waterloo, Canada

Abstract Solar cells on lightweight and flexible substrates have advantages over the glass- or wafer-based photovoltaic devices in both terrestrial and space applications. Here, we report on development of amorphous silicon thin film photovoltaic modules fabricated on $100 \,\mu$ m thick plastic substrates. The $10 \times 10 \,\mathrm{cm^2}$ area module consists of 72 rectangular cells, which are *a*-Si:H n-i-p structures. Current–voltage characteristics are presented and analysed. Leakage currents and defects were visualized using infrared imaging.